

各位

平成 30 年 12 月 12 日

放射線取扱主任者

波戸 芳仁

エックス線発生装置の新規使用について

平成 30 年 12 月 12 日付をもって提出のあったエックス線発生装置の新規使用について、下記の条件を付して許可します。

- 1.機器名： PANalytical 社製 X 線回折装置 Aeris Research edition CuLFF
セラミック管球
- 2.使用場所： 化学実験棟微量分析室
- 3.所長等： 佐々木 慎一
- 4.エックス線装置責任者： 古宮 綾
- 5.性能等： 最大印加電圧：40kV
最大電流：15mA
- 6.使用条件： 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構エックス線
装置取扱い規則を順守して使用する事

配布先

- : 機構長
- : (素核研) 所長, 副所長
- : (物構研) 所長, 副所長
- : (加速器) 施設長, 総主幹, 各主幹
- : (共通) 施設長, 各センター長, 管理室員, TNS
- : 安全衛生推進室